

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 1 月 6 日 (06.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/000801 A1

(51) 国際特許分類⁷:
C08F 4/00, 2/50, C08G 59/02

C07C 381/12,

(74) 代理人: 荒井 鐘司, 外 (ARAI, Shoji et al.); 〒1030023
東京都中央区日本橋本町 4 丁目 4 番 1 1 号 永井ビ
ル 荒井山本法律特許事務所 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/008971

(22) 国際出願日: 2004 年 6 月 25 日 (25.06.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2003-180712 2003 年 6 月 25 日 (25.06.2003) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): サン
アプロ株式会社 (SAN-APRO LIMITED) [JP/JP]; 〒
6050995 京都府京都市東山区一橋野本町 1 1 番地
Kyoto (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊達雅志 (DATE,
Masashi) [JP/JP]; 〒6050995 京都府京都市東山区一
橋野本町 1 1 番地 Kyoto (JP). 木村秀基 (KIMURA,
Hideki) [JP/JP]; 〒6050995 京都府京都市東山区一橋
野本町 1 1 番地 Kyoto (JP). 山下進二 (YAMASHITA,
Shinji) [JP/JP]; 〒6050995 京都府京都市東山区一橋
野本町 1 1 番地 Kyoto (JP). 山元二郎 (YAMAMOTO,
Jiro) [JP/JP]; 〒6050995 京都府京都市東山区一橋野本
町 1 1 番地 Kyoto (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US,
UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可
能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD,
SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY,
KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE,
IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF,
BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN,
TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受
領の際には再公開される。

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCTION OF MONOSULFONIUM SALTS, CATIONIC POLYMERIZATION INITIATORS,
CURABLE COMPOSITIONS, AND PRODUCTS OF CURING

(54) 発明の名称: モノスルホニウム塩の製造方法、カチオン重合開始剤、硬化性組成物および硬化物

(57) Abstract: A monosulfonium salt bearing one sulfonio group in the molecule and having a purity of 96 % or above is produced without purification with a decrease in the amount of residual unreacted reactants. An aryl compound (a), a sulfoxide compound (b), a dehydrating agent (c), and a salt (d) of an alkali metal or an alkaline earth metal with BF₄, PF₆, AsF₆, or SbF₆ are charged into a reaction system, followed by the charging of an inorganic acid (e), whereby the aryl compound (a) is condensed with the sulfoxide compound (b) through dehydration.

(57) 要約: 未反応原料の残存量が少なく、純度が 96 % 以上である分子中にスルホニオ基を 1 個有するモノスル
ホニウム塩を精製工程なしに製造する。アリール化合物 (a)、スルホキシド化合物 (b)、脱水剤 (c)、お
よびアルカリ金属またはアルカリ土類金属の BF₄、PF₆、AsF₆ または SbF₆ 塩 (d) を反応系内に仕込んだ後
に、無機酸 (e) を仕込んで、アリール化合物 (a) とスルホキシド化合物 (b) を脱水縮合させる。

WO 2005/000801 A1